

平成 25 年度 三洋半導体・群馬大学連携大学院

博士後期課程：次世代集積回路工学特論／博士前期課程：集積回路設計技術

5 月 30 日（14:20～15:50,16:00～17:30）総合研究棟 5 0 2 号室

プロセス技術 講義概要

三洋半導体(株) プロセス技術開発部 植田 慶一

LSI を製造するためのプロセス技術について、リソグラフィー、エッチング、ゲート酸化、イオン注入、CVD、配線などの要素技術を原理的な観点から学習する。また信頼性の面から各要素技術に要求される項目についても概括し、理解を深める。

これら要素技術を組み合わせた LSI 製造のプロセスフローを学習するとともに、最新技術についても紹介し、LSI 回路設計関連の研究者や技術者に必要な製造プロセス技術の知識を習得する。

以上